平成23年度研究開発成果概要書 「量子もつれ中継技術の研究開発」 課題イ2:遠隔ノード間での量子もつれ純粋化技術 副題:光パルス制御量子ドットスピンと単一光子に基づく方式

(1)研究開発の目的

量子もつれ中継技術の目指すところは、量子もつれ状態を遠く離れた 2 地点 に生成し、これを長期間保存し、必要(緊急)な時に、これを用いてセキュリ ティーの様々な高い通信プロトコルを実現することにある。不完全なデバイス と不完全な制御技術から、上記目標を実現する完全なシステムを作り上げるた めには、図1に示すような誤り耐性量子中継器の階層構造アーキテクチャーの 全ての技術を相互に矛盾なく接続できるように開発していくことが必要である。 本研究に先立って行われた量子中継技術に関する5年間の研究を通して、現実 的な量子中継システムの全体像を描くことができるようになった。その概略は、 1. 量子メモリーは 2 次元正方格子上に並べられた量子ドットスピンアレイであ り、量子もつれ状態は、2つの量子ドットからの自然放出による識別できない単 一光子の発生と同時検出で生成される。2. 量子ビット情報は、2 次元トポロジカ ル表面コードにより保存される。3. 各中継器間の量子もつれ状態のスワッピン グ(長距離化)はシステム全体に生成された2次元トポロジカル表面コードへ の射影測定による論理量子ビットの伝送自体により実現される。4. 双方の量子 ドットからの単一光子(波長 0.9μm)は、PPLN 導波路デバイスにより、波長 1.5 μmの単一光子へ波長変換され、光ファイバー伝送路へ送出される。5. 識別でき ない単一光子の同時検出により、光ファイバー伝送路の位相安定化が自動的に 実現され、フィデリティーの高い量子もつれ状態が生成される、とまとめられ る。

図1の最下層である物理層では、半導体(InGaAs)量子ドットスピンを量子 ビットとし、光パルスのみで初期化、1ビット制御、2ビット制御、射影測定の 全てを実現し、これをもって量子メモリーとする。第2層であるバーチャル層 では、リフォーカシングやデカップリングといった手法を用いて、スピン量子 ビットのデコヒーレンス時間を改善する。第3層である量子誤り訂正層では、2 次元トポロジカル表面コードを用いてデコヒーレンスとゲート操作エラーを除 去した論理量子ビットを実現する。第4層である論理層では、第3層で実現さ れた論理量子ビットを2地点に配し、その間に量子もつれ状態を生成・純粋化 する量子中継アルゴリズムを実装する。量子もつれ状態の生成は、2つの量子メ モリーから識別できない単一光子を発生し、この2つの単一光子を衝突、同時 検出することにより実現される(図2)。

添付1



これまでの5年間の量子メモリー素子の開発は、図3(a)に示す GaAs 基板上の

InGaAs 自己形成量子ドットに電子を1つトラップし、これをプレーナマイクロ キャビティー中に閉じ込めた後、電子ビームリソグラフィー技術を用いてポス ト形状に加工することにより、単一量子ドットを切り出した素子を用いて行わ れてきた。この手法では、単一の量子メモリーは作製できても、多数の量子メ モリーの同一チップへの集積化を実現することはできない。そこで、図3(b)に 示すように、2次元正方格子上に量子ドットを規則的に配置し、これを2次元プ レーナマイクロキャビティーに閉じ込めただけのシンプルな構造の素子に置き 換える必要がある。この2次元正方格子上に規則的に並べられた量子ドットを 実現する手段として、ゲート制御型量子ドットは有望な候補のひとつである。

(a)



図3(a)(b) ポストマイクロキャビティー中の自己形成量子ドットとプレー ナマイクロキャビティー中の2次元正方格子上のゲート制御型量子ドット アレイ

この量子メモリー素子を光パルスを用いて高速で操作する概念図が図 4 に示 されている。各量子ドットには、単一電子もしくは単一正孔スピンがトラップ されており、MBE 成長方向と垂直な方向に直流磁場がかけられている(フォイト 配置)。スピン量子ビットの振動周波数(ゼーマン分裂で決まるラーモア周波数) は、数十 GHz のオーダーである。単一光子を発生する量子ドットを除いて、量 子ドット励起子発光エネルギーはプレーナマイクロキャビティーの共鳴エネル ギーよりも高エネルギー側に配置される。QNDパルスと呼ばれるパルス幅 Insec 程度の光パルスは、プレーナマイクロキャビティーの共鳴エネルギーに同調し ており、垂直に入射し、反射する。偏波干渉計を介して、スピン量子ビットの 射影測定を実現する。Broadbandパルスと呼ばれるパルス幅 1psec 程度の光パル スは、プレーナマイクロキャビティーのストップバンドの外側(低エネルギー 側)の最初の dip に共鳴したエネルギーを持ち、斜めの入射角度で入射する。 非共鳴誘導ラマン散乱を介して、スピン量子ビットの1ビット制御を実現する。 量子ドット励起子発光からの離調は約 1THz である。Entangling パルスと呼ばれ るパルス幅 100psec 程度の光パルスは、プレーナマイクロキャビティー光子と 量子井戸励起子が作る下方ポラリトンに共鳴したエネルギーを持ち、垂直に入 射する。状態ベクトルのユニタリ発展(幾何学的位相)を介して、隣り合う 2 つの量子ビット間に制御位相ゲートを実現する。これら 3 種類の光パルスの照 射は、シリコン MEMS ミラーアレイを介して実現される。



図4 量子中継素子の構成。

正方格子上に規則的に並べられたスピン量子ビットは、図 5 に示すように量子情報を格納するデータビットと誤りを検出するシンドロームビットに分けられる。データビット 6 個とシンドロームビット 2 個からなる各基本格子で、2 つの量子ビット間に制御 NOT ゲートを 8 回施して、量子誤り訂正が実現される。この量子誤り訂正方式は、2 次元トポロジカル表面コードと呼ばれ、ゲートエラーが 1.4%であっても誤り耐性を実現し、正しく動作する現時点で発見されている最も優れた量子誤り訂正コードである。格子リフレッシュは、 T_2 時間内に約1000回行われる。従って $T_2=3\mu$ sec とすると、制御 NOT ゲートは、約300psec で実現されなければならない。光パルスで制御された量子ドットスピンは、後



2つの量子中継器の間での量子もつれ状態の配信は、図2に示す原理により実現される。2つの量子ドットにパルスポンプ光により励起子が注入される($|ex >_1|ex >_2$)。 この励起子状態は、 ω_1 の光子を放出してスピン励起状態へ緩和するか、 ω_2 の光子を放出してスピン基底状態へ緩和する。伝送路の中間点で、 $\omega_1 > \omega_2$ の光子を1つずつ同時計測できた場合には、どちらの量子ドットから $\omega_1 > \omega_2$ の光子が放出されたのか分からないので、2つの量子ドット中のスピン量子ビットは量子もつれ状態になる。この時、量子ドットから放出される波長 0.9 μ mの単一光子は、光ファイバー伝送路へ送出される前に、PPLN 導波路デバイスで波長 1.5 μ m へ変換される。

以上のような誤り耐性機能を持った量子もつれ中継技術を念頭において、本 研究では、次のようなハードウェア技術の課題に取り組む。

- (1) InGaAs 量子ドット中の電子スピンもしくは正孔スピンのデコヒーレンス時間内に行える1ビット制御の回数を10⁵以上にする。このため、光パルス列によるリフォーカシング法やデカップリング法を用いてデコヒーレンス時間を3µsec以上にすると同時に、光パルスによる1ビットゲート時間を決定するスピンのゼーマン(ラーモア)周波数を20GHz以上として1ビット制御時間を25psec以下にする。
- (2) InGaAs 量子ドットから発生する波長 0.9µmの単一光子を、周波数下方変換 技術を用いて波長 1.5µm へ高効率、低雑音で変換する。このため、2 種類 の PPLN 導波路デバイスを新たに開発し、波長 2µmのポンプ光源と波長 1.5 µm への単一光子波長変換器として、それぞれ使う。波長 0.9µm から波長 1.5µm への変換量子効率は 25%以上、ラマン散乱雑音光子によるフィデリテ ィー劣化は 5%以下のレベルに抑える。
- (3) InGaAs 量子ドットから発生する単一光子を高効率で外部の単一モード光学 系へ取り出すために、量子ドットをプレーナマイクロキャビティーの中へ埋

述するようにこの条件をクリアできる。

め込む。ポスト形状やフォトニック結晶へ加工を施すことにより、量子効率 は大幅に改善されるが、そのような3次元構造共振器は、2次元トポロジカ ル表面コードの実装を著しく困難にするので、プレーナマイクロキャビティ 一構造のみで、取り出し量子効率10%以上を実現する。

- (4) 上記 3 つの技術を組み合わせて 1 つの量子ドットスピン状態と波長 1.5μm の単一光子偏波状態の間に量子もつれ状態を生成する。光ファイバー50km 伝送後の量子もつれ状態の生成レートが 1kHz、フィデリティーが 80%以上で あることを実現する。
- (5) InGaAs 量子ドット中の電子スピンもしくは正孔スピンのシングルショット 射影測定(量子非破壊測定)を光パルスを用いて高速・低雑音で実現する。 このためにも、プレーナマイクロキャビティーよりも複雑な共振器構造は取 り入れない。スピンのデコヒーレンス時間内に 1000 回以上の射影測定がで きるよう測定時間を 3nsec 以下で実現する。
- (6) 隣接する2つのスピン量子ビット間に、光パルスを用いて2ビットゲートを 実装する方法を理論的に提案する。このためにも、プレーナマイクロキャビ ティーよりも複雑な共振器構造は取り入れない。スピンのデコヒーレンス時 間内に10,000 回以上の2ビット演算ができるよう、ゲート時間を300psec 以下で実現する手法を探索する。
- (7) 上記 6 つの技術を総合的に組み合わせて、2 つの量子メモリーから波長 1.5 µmの単一光子を発生し、これを衝突させ、同時検出することにより、2 つ の量子メモリー間に高フィデリティーの量子もつれ状態を生成する。光ファ イバー長 50kmの伝送後、量子もつれの生成レートが 1Hz 以上、フィデリテ ィーが 80%以上であることを実現する。

(2)研究開発期間

平成 23 年度から平成 27 年度(5 年間)

(3)委託先企業 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構

(4)研究開発予算(百万円)

平成 23 年度	55	(奜	「約金	≹額)
平成 24 年度	52	(]])
平成 25 年度	49	(]])
平成 26 年度	46	(]])
平成 27 年度	43	(]])

- (5)研究開発課題と担当
 - 課題イ-1 量子ドットスピンメモリーの光パルス制御技術 課題イ-2 単一光子の高効率・低雑音波長変換技術 課題イ-3 スピン-光子間量子もつれ状態の生成技術 課題イ-4 光パルスによる単一スピンの射影測定技術

課題イ-5 2 つの量子メモリー間の量子もつれ状態生成技術 (大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構)

(6) これまで得られた研究開発成果

		(累計)件	(当該年度)件
特許出願	国内出願	0	0
	外国出願	0	0
外部発表	研究論文	3	3
	その他研究発表	3	3
	プレスリリース	0	0
	展示会	0	0
	標準化提案	0	0

具体的な成果

(1) 原子核スピンとの結合を抑圧できる正孔スピン量子ビットの開発

InAs 量子ドット中の電子スピン量子ビットは、結晶構成原子である In と As の原子核スピンと強いハイパーファイン結合を有するため、電子スピンを光パ ルスで制御する際、核スピンの光ポンピング効果による様々な非線形効果を誘 発し、安定なゲート操作が実現しにくいという欠点があった。この問題を克服 するためには、ブロッホ関数が p 波であることにより原子核スピンとのハイパ ーファイン結合が小さい正孔スピンを電子スピンの代わりに使うことが有効で あると考えられる。

図1に InAs 量子ドット正孔スピンのエネルギーレベル(図1a)、光パルス制 御実験系(図1b)、観測されたコヒーレントラビ振動波形(図1c)、ラムゼー干 渉縞(図1d, e)を示す。ピコ秒光パルスを用いて、電子スピンと同様の量子ビ ット操作が正孔スピンに対して出来ることが明らかになった。



図2は、原子核スピンとの結合が電子スピンに比べて正孔スピンでは抑圧され ていることを確認した結果を示している。図2aとbは、2つのπ/2パルスで構 成されたラムゼー干渉計の干渉波形を電子スピンと正孔スピンに対して観測し た結果を比較している。電子スピンでは、遅延時間τを上げていった時と下げて いった時で、異なった波形が観測されるのに対し、正孔スピンではそのような 異常な振舞いは見られない。図2cとdは、共鳴吸収線を電子スピンと正孔スピ ンに対して観測した結果を比較している。電子スピンでは波形を上げていった 時と下げていった時で異なった波形(ヒステリシス)が観測されるのに対し、 正孔スピンではそのような異常な振舞いは見られない。これは、電子スピンを 用いた系では、原子核スピンの光ポンピング効果による非線形フィードバック ループが存在するのに対し、正孔スピンを用いた系ではそのようなフィードバ ックループが存在しないためである。



図 2

図 3 には、正孔スピン量子ビットのデコヒーレンス特性が示されている。ラム ゼー干渉縞のビジビリティーはガウス関数で減少していくことが分かる。(図 3a と b)。観測された T₂*時間は 2. 3nsec であった。この T₂*時間は量子ドットにかか る電場のゆらぎがスピンー軌道角運動量結合を介して、ラーモア周波数を変調 するに由来することが確認された (図 3c と d)。スピンエコー法を用いて、この 電場ゆらぎの影響を取り除くと、T₂時間は、1. 1 μ sec に改善された(図 3e と f)。



(2)2ビットゲート時間の短縮化

2つの隣接する量子ドット間に2ビットゲートを実装するスキームとして従来は 外部からコヒーレンス光を注入し、共振器内に生成される光電場の時間応答が2 つの局在スピンの状態に依存して異なった振舞いを示すことを利用した制御位 相ゲートを提案していた(Phys. Rev. B 84, 235307, 2011)。しかしこの手法 では、2ビットゲートにかかる時間は10~100nsecというオーダーであった。し かしトポロジカル表面コードを使って誤り耐性量子中継器を実現するためには、 スピン量子ビットのデコヒーレンス時間(T₂~3µsec)内に、10,000回程度の2 ビットゲートを実施しなければならないことが分かっている。従って、ゲート 時間を300psec以下に減少することが必要とされる。

図 4 に励起子ポラリトンを介した制御位相ゲートの実装法の原理を示す。図 4 に励起子ポラリトンを介した制御位相ゲートの実装法の原理を示す。図 4(a)に示すように、プレーナマイクロキャビティー内には、単一の量子井戸が 埋め込まれており、DC 電場でトラップされた局在電子が存在する。この系に存 在する励起子ポラリトンのエネルギーE 対運動量 k の分散曲線を図 4(b)に示す。 k=0 における下方ポラリトンの共鳴エネルギーは、2 つの電子スピンの 3 通りの 状態 | ↑ ↑>、 | ↑ ↓>又は | ↓ ↑>、 | ↓ ↓>による異なる。これは、局在スピンと 励起子ポラリトンの交換相互作用によるものである。

この時、3つの共鳴エネルギーよりも低いエネルギーを持った外部コヒーレン ス光をプレーナマイクロキャビティーに注入すると、図 5 に示すように、キャ ビティー内部の電場の複振幅 α は 3 通りのスピン状態に対して異なった軌跡を 描く。 $Im(\alpha)$ -Re(α)位相空間の中で、3 つの軌跡で囲まれた面積が $2\pi \times N$ 、 $2\pi \times M$ 、 $2\pi \times L+\pi$ (N, M, L は正の整数) となる時、制御位相ゲートが実現さ れる。図6に規格化外部コヒーレント光振幅Ωと光パルス幅τに対して計算され た制御位相ゲートのフィデリティーF を示す。Ω=159.88meV、τ=201.88psec の 時、F=99.99%が実現されることが分かる。









(3)1.5µm単一光子検出用2ステップアップコンバーター 量子中継技術では、長距離光ファイバーを伝搬する単一光子は1.5µm、これを 検出するアバランシェフォトダイオード(APD)は室温動作、低ダークカウント、 高効率検出を実現しうるSi-APDが使われると予想される。しかしSi-APDの最 大量子効率は0.55~0.6µm帯にあるため、1.5µm帯の単一光子を0.55~0.6µ m帯に周波数変換する必要がある。

図7にこれを実現する PPLN 導波路2ステップアップコンバーターの原理を示 す。図7(a)に示すように1.55 μ mの単一光子は、1.88 μ mのポンプ光との和周 波発生により、一旦0.83 μ mに変換され、さらに1.88 μ mのポンプ光との和周 波発生により、0.57 μ mへ変換される。図7(b)に示すように、2つの異なった周 期構造を持つ PPLN 導波路により、このような2ステップアップコンバージョン が実現される。



図8には実験系が示されている。図9には、和周波数発生のための位相整合を 温度チューニングで取れること、周波数変換効率が最大88%になることを示した 実験結果が示されている。更に、図10には最終的にSi-APDで0.57 µmの単一 光子を検出した時のタイミングジッターが67psecに抑えられることを示してい る。





(7)研究開発イメージ図 添付